

講演会の御案内

第284回応用セラミックス研究所講演会

平成26年度東京工業大学応用セラミックス研究所共同利用研究

「微小領域が司る新規なスピン・電子・光機能の探索」

日時:平成27年3月20日(金)

場所:東京工業大学すずかけ台キャンパス J2棟20階中会議室

13:30 ～14:00	「ナノ領域における偏光状態の計測及び制御」	石橋隆幸, 蔡永福 (長岡技術科学大学 物質・材料系)
14:00 ～14:30	「化学的手法を用いた高飽和磁化鉄基ナノ粒子の低温合成とその集合体の動的磁気特性」	小川智之 (東北大学 大学院工学研究科電子工 学専攻)
14:30 ～15:00	「Pd(100)超薄膜の量子井戸状態に起因する強磁性とその応用」	櫻木俊輔, 佐藤徹哉 (慶應義塾大学 大学院理工学研究科 総合 デザイン工学専攻)
15:00 ～15:30	“Temperature dependence of magnetic anisotropy in Mn ₅ Ge ₃ epitaxial thin films”	Alain Truong, Kohei M. Itoh (Department of Applied Physics and Physico- Informatics, Keio University)
15:30 ～15:50	休憩	
15:50 ～16:20	「エピタキシャルCo系ホイスラー合金を用いた熱流-スピン流変換」	浜屋宏平 (大阪大学 大学院基礎工学研究科)
16:20 ～16:50	「負のスピン分極を有するFe ₄ N薄膜からのスピン流生成とダイナミクス」	磯上慎二 (福島工業高等専門学校)
16:50 ～17:20	「強磁性薄膜/強誘電体ヘテロ界面における磁気異方性の電界制御」	谷山智康 (東京工業大学 応用セラミックス研究所)